1B05

ラジカル-ラジカル(CH+NO)反応の回転量子状態依存の解明:

- 回転状態で異なる並進エネルギー依存
- (阪大院理) 長町 有起、大山 浩、山川 潔、笠井 俊夫

【序】我々は六極電場によって集束された純粋な CH ビームを開発し[1]、この CH ビームを 用いて以下の化学発光チャンネルを直接観測した。

$$CH(X^2) + NO(X^2) = NH^*(A^3) + CO(X^{1+})$$
 (1a)

 $H(^{2}S) + NCO^{*}(A^{2})$

(1b)

また、回転量子数 N = 1 と N = 2(N はスピンを除いた全角運動量)での著しい反応断面積の変 化と、(1a)と(1b)の分岐比には回転状態依存性が見られないことを明らかにした。これらの 結果から共通の反応中間体を経由して反応が進むことを提唱した。[2] さらに、配向 CH ビ

ームを用いて立体効果の測定を行ったところ、 J,F,M> = 3/2,1,3/2>とN = 2(3/2,2,3/2>と 5/2,2,5/2>)でアライメントの効果が逆転するこ とがわかった。これらの結果をまとめたものが図 1 である。Bocherel らによってCH + NO反応の 全反応速度定数は負の速度依存性を示すことが報 告された。[3](1a)のチャンネルも同様に負の速 度依存性を持つとすると、引力ポテンシャルで進 行する反応において反応断面積、立体効果が回転 状態によって変化するという特異な現象を見いだ したことになる。今回、この点を検証するため回 転選別された CH ビームを飛行時間法で速度選別



することで、(1a)の反応における反応断面積の並進速度依存性の回転状態依存性を測定した。 【実験】回転状態 J,F,M> = 3/2,1,3/2>(N = 1)のみが集束する六極電場印加電圧 3 kV と主 に N = 2 が集束する 5 kV の条件で測定を行った。六極電場で回転状態選別された CH を回 転チョッパーで切り出し速度選別した。この速度選別された CH の TOF スペクトルは LIF 法のレーザーの遅延時間を変えることによって、一方、 NH(A)化学発光の TOF スペクトル は CH を NO で満たされたセル内に通し、NH(A)の発光を時間分解することによって得た。 これらを用いて反応断面積の並進速度依存を決定した。

【結果と考察】図 2 は CH と NH(A)の TOF スペクトルであり、(a)は J,F,M> = 3/2,1,3/2> の場合、(b)は N = 2 の場合である。この図から CH と NH(A)のスペクトルは大きく異なり、 低速部分で CH が LIF で検出できない程微量であるにも関わらず、NH(A)が生成しているこ とがわかる。従って、この反応には反応断面積 の著しい並進速度依存性があることがわかる。 この依存を図示したものが図3であり、高速域 では全く反応しない顕著な負の速度依存が明ら かになった。また、N=2の方がJ,F,M>= 3/2,1,3/2>よりも反応性が高いことがわかる。 この結果から図1の回転状態による反応断面積 の変化は、回転状態によって反応断面積の並進 速度依存性が異なることによるものだとわかる。

反応断面積が負の速度依存性を示したことが 引力性ポテンシャルを経る反応過程を反映して いるとすれば、引力性ポテンシャルによる中間 体生成過程において、生成確率とその速度依存 性、立体効果が回転状態により変化するという 結果を示している。従って、ラジカル -ラジカ ル反応である CH + NO 反応では、原子-分子系の ようなポテンシャルの単純な平均化はおこらず、 ラジカル-ラジカル間の回転相関により回転状態 を反映した不均一な平均化が起こると期待され る。

著しい反応断面積の負の速度依存性を解明す るためにはより低速域での研究が不可欠である。 このために現在、単一量子状態選別可能な低速 CH ラジカル源の開発に取り組んでいる。反応 断面積の並進速度依存の回転状態依存性から高 速域では反応しなかった J,F> = 1/2,2>も低速 では反応するのではないかと予測される。当 日はこちらの結果も含めて議論していきたい。



図 2 CH()とNH(A)()のTOFスペクトル



【参考文献】

[1] K. Ikejiri, H. ohoyama, Y. Nagamachi, and T. Kasai, Chem. Phys. Lett. 401, 465(2005)

[2] Y. Nagamachi, H. ohoyama, K. Ikejiri, and T. Kasai, J. Chem. Phys. 122, 064307(2005)

[3] P. Bocherel, L. B. Herbert, B. R.owe, I. R. Sims, I. W. M. smith, and D. travers, J. Phys. Chem. **100**, 3063(1996)